



Gewinner des
productronica
innovation award 2021

Cluster Semiconductors – AP&S International GmbH



CleanSurF

Der neue AP&S CleanSurF® Reiniger gewährleistet die Sauberkeit standardisierter Wafer Transportbehälter wie FOUPs, SMIFs, Carrier und Boxen nach höchsten Reinheitsstandards, um die Prozessketten in der Halbleiterfertigung zu sichern und eine maximale Produktivität zu erreichen. Hoher Durchsatz, optimale Reinigungsleistung, maximale Flexibilität im Einsatz und attraktive Betriebskosten sind die Vorteile der neuen Reinigungsanlage. Das Besondere des CleanSurF® Produktkonzeptes ist, dass der Reiniger

sowohl für die manuelle als auch für die automatische Beladung ausgelegt ist. Er kann auch an einen FOUP-Stapler angeschlossen werden, um die Reinigung während der Zwischenlagerung der Behälter zu garantieren.



Tobias Bausch, CMO & CTO:

„Bei der Produktentwicklung waren für uns folgende Überlegungen entscheidend: Wir wollten einen Cleaner nach neuestem technischen Standard entwickeln, welcher sowohl die manuelle wie auch automatische Beladung ermöglicht und die Kapazität unserer bisherigen Cleaner erhöht. Unser Ziel - eine Anlage mit effizientem Durchsatz und attraktiven TCO zu realisieren, haben wir mit unserem neuen CleanSurF® erreicht“

Über AP&S International

AP&S International GmbH ist ein führender Anbieter von chemischen Nassprozessanlagen für die Halbleiterindustrie. Zu unseren Kunden zählen weltweit marktführende Hersteller von Mikrochips, MEMS und Optoelektronik. Charakteristisch für unsere Anlagen sind: hoher Durchsatz, überlegene Prozessleistung, attraktive TCO-Werte und maximale Flexibilität (Bridge tools und kundenspezifische Lösungen). Unser Portfolio umfasst Batch- und Single-Wafer-Anlagen, einschließlich manueller, halbautomatischer und vollautomatischer Nassprozessmaschinen, sowie produktionsunterstützende Anlagen wie Reiniger für FOUP, SMIF und Boxen, Laborgeräte und Chemikalienmanagementsysteme. Die Anlagen von AP&S decken alle gängigen chemischen Nassprozesse ab, die in der Halbleiterproduktionskette verwendet werden, wie z. B. Reinigen, Ätzen, Strippen, Beschichten, Entwickeln, Metallätzen, E-less Plating, Lift-off und Trocknen. Unsere Anlagen verarbeiten Masken und Wafer bis zu 300mm, einschließlich verschiedener Substratdicken und Wafermaterialien wie Silizium-Si, Siliziumkarbid SiC, Galliumnitrid GaN, Galliumarsenid GaAs, Saphir und Glas. Der Hauptsitz von AP&S befindet sich in Donaueschingen, Deutschland. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens sind in China, Singapur und Malaysia.

www.ap-s.com

AP&S International GmbH
Obere Wiesen 9
78116 Donaueschingen
Deutschland

Kontakt
Aljora Barberio
aljora.barberio@ap-s.de